

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2012-126967(P2012-126967A)

【公開日】平成24年7月5日(2012.7.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-026

【出願番号】特願2010-280396(P2010-280396)

【国際特許分類】

C 2 3 C 18/31 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 18/31 E

【手続補正書】

【提出日】平成25年2月25日(2013.2.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 4 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 4 4】

引き続き、同様の操作を繰り返してめっきを行ったところ、処理する基板19の積算面積が410m<sup>2</sup>になった時点においても問題なくめっき処理が可能であった。初期のめっき液比重1.032(at 20)であったのに対し、このときのめっき開始時点では比重1.103に増加した。これは、硫酸ニッケルの補給によりめっき液中に硫酸イオンが増加したことによるものである。しかし、処理する基板19の積算面積が410m<sup>2</sup>になった時点でもめっき液はきわめて安定であり、めっき槽2、曝気槽4及び金属ニッケル溶解槽の内壁にはニッケルの析出が認められなかった。また、めっき膜も光沢を呈する平滑な表面であった。